

Top	Item	Previous	Next
-----	------	----------	------

## LIQUID CRYSTAL PANEL PRODUCTION APPARATUS

JP2934438

<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Patent Assignee</b> SHINETSU ENG CO LTD</li><li>• <b>Inventor</b> ISHIZAKA ICHIRO; TAKEFUSHI NORIYUKI; KOGA YASUYUKI; KATAGIRI KIYOO</li><li>• <b>International Patent Classification</b> G02F-001/13G02F-001/133G02F-001/1339</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Publication Information</b> JP2934438 B2 19990816 [JP2934438]</li><li>• <b>Priority Details</b> 1998JP-0235637 19980821</li></ul>																
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>FamPat family</b><table><tr><td>JP2934438</td><td>B2</td><td>19990816</td><td>[JP2934438]</td></tr><tr><td><del>JP2000066248</del></td><td><del>A</del></td><td><del>20000303</del></td><td><del>[JP2000066248]</del></td></tr><tr><td>KR20000016847</td><td>A</td><td>20000325</td><td>[KR20000016847]</td></tr><tr><td>TW491955</td><td>B</td><td>20020621</td><td>[TW-491955]</td></tr></table></li></ul>		JP2934438	B2	19990816	[JP2934438]	<del>JP2000066248</del>	<del>A</del>	<del>20000303</del>	<del>[JP2000066248]</del>	KR20000016847	A	20000325	[KR20000016847]	TW491955	B	20020621	[TW-491955]
JP2934438	B2	19990816	[JP2934438]														
<del>JP2000066248</del>	<del>A</del>	<del>20000303</del>	<del>[JP2000066248]</del>														
KR20000016847	A	20000325	[KR20000016847]														
TW491955	B	20020621	[TW-491955]														

### • Abstract :

(JP2934438)

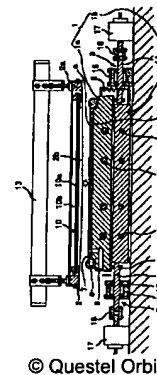
**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a liquid crystal panel production apparatus which is capable of uniformly heating the entire surface of glass substrates, acting the pressurization of these glass substrates as a uniform distribution load and further rapidly cooling surface plates after a heating treatment.

(JP2934438)

**SOLUTION:** The device consists of the one stationary surface plate 1 which holds two sheets one set of the aligned and temporally fixed glass substrates and the moving surface plate 2 which faces this stationary surface plate 1, is capable of varying the spacing from the surface plate 1 and is pressurized by a pressurizing means. The stationary surface plate 1 is composed of a two-layered structure obtd. by embedding a cooling means 4 in an upper layer member 1a on the side nearer the glass substrates (a), (b), equipping the lower layer member 1b on the side distant therefrom with a heating means 5 and further providing the plate with a separating mechanism 3 for disconnecting the contact states of the upper and lower members 1a, 1b. The moving surface plate 2 is composed of a hollow structure equipped with the heating means 5 and the pressurizing surface in contact with the glass substrates (a), (b) is composed of a member having flexibility.

(JP2934438)

COPYRIGHT: (C)2000,JPO



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-66218

(P2000-66218A)

(43) 公開日 平成12年3月3日(2000.3.3)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テーマコード <sup>*</sup> (参考)
G 0 2 F 1/1339	5 0 5	G 0 2 F 1/1339	5 0 5 2 H 0 8 9

審査請求 有 請求項の数 3 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平10-235637

(22) 出願日 平成10年8月21日(1998.8.21)

(71) 出願人 000190105

信越エンジニアリング株式会社

東京都千代田区神田錦町2丁目9番地

(72) 発明者 石坂 一朗

東京都千代田区神田錦町2丁目9番地 信

越エンジニアリング株式会社内

(72) 発明者 竹節 憲之

東京都千代田区神田錦町2丁目9番地 信

越エンジニアリング株式会社内

(74) 代理人 100068607

弁理士 早川 政名 (外2名)

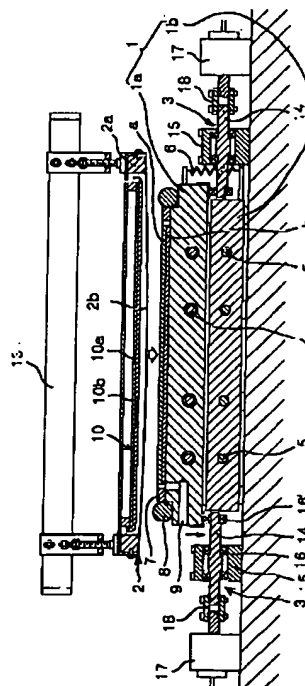
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶パネル製造装置

(57) 【要約】

【課題】 ガラス基板の全面を均一に加熱できると共に、該ガラス基板の加圧も均一な分布荷重として作用させることができ、更に加熱処理後定盤を素早く冷却できる液晶パネル製造装置を提供することにある。

【解決手段】 位置合わせし、且つ仮止めされた2枚一組のガラス基板を挟着する一方の固定定盤と、その固定定盤と対向して該定盤との間隔を広狭可変すると共に、加圧手段で加圧される可動定盤とから成り、前記固定定盤は2層構造としてガラス基板に近い側の上層部材に冷却手段を埋設し、遠い側の下層部材に加熱手段を装備し、更に前記上・下層部材の接触状態を切り離す分離機構を設け、且つ可動定盤は加熱手段を装備した中空構造とすると共にガラス基板と当接する加圧面は可撓性を有する部材で構成する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 2枚のガラス基板をスペーサを介在させて向き合わせ、重ね合わせた状態で加熱・加圧し、上記2枚の基板間に配した熱硬化性樹脂からなるシール材を硬化させる液晶パネル製造装置において、位置合わせし、且つ仮止めされた2枚一組のガラス基板を挟着する一方の固定定盤と、その固定定盤と対向して該定盤との間隔を広狭可変すると共に、加圧手段で加圧される可動定盤とから成り、前記固定定盤は2層構造としてガラス基板に近い側の上層部材に冷却手段を埋設し、遠い側の下層部材に加熱手段を装備し、更に前記上・下層部材の接触状態を切り離す分離機構を設け、且つ可動定盤は加熱手段を装備した中空構造とすると共にガラス基板と当接する加圧面は可撓性を有する部材で構成したことを特徴とする液晶パネル製造装置。

【請求項2】 上記可動定盤が、中空部にヒーター付反射板を内蔵したものである請求項1記載の液晶パネル製造装置。

【請求項3】 上記可動定盤における可撓性の加圧部材が、ガラス基板と同程度の熱膨張率を有する可撓性のフィルムである請求項1又は請求項2記載の液晶パネル製造装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は液晶パネルの製造装置に係り、詳しくは熱硬化性樹脂のシール材を挟装した上下のガラス基板を加熱・加圧して該シール材を硬化させ、所定の間隔を確保した液晶パネルを形成する製造装置に関する。

## 【0002】

【従来の技術】液晶パネル(LCD)は、透明導電性電極をコートした2枚のガラス基板間に数 $\mu\text{m}$ のスペーサを挟装して両ガラス基板間を所定の間隔に保ち、両ガラス基板間の周囲をシール材で区画した内側の空間内に液晶を封入したもので、その2枚のガラス基板は位置合わせマークによって狂いなく貼り合わせられている。

【0003】ところで、液晶パネルを構成する2枚のガラス基板は、その一方のガラス基板の上にスペーサを散在し、他方のガラス基板の内面(一方のガラス基板と対向する面)には熱硬化性樹脂のシール材が取付けられ、そうした上下のガラス基板が貼り合わせ装置によってマーク合わせを行って貼り合わせられると共に、上下のガラス基板が分離しないように仮止めされる。そして、貼り合わせ仮止めされた2枚1組のガラス基板は加熱、加圧処理して上下のガラス基板間のギャップをスペーサの粒径までシール材を加圧して該シール材を硬化させる。

【0004】その従来のシール材を硬化させる装置は、貼り合わせ仮止めした2枚1組のガラス基板の少なくとも一方の基板を可撓性材料で覆うようにし、パネルを取めた容器内を減圧にし、あるいは容器を外部から加圧し

た状態で基板の固着を行うようにしている。以上のような構成にすることで、基板に均一に圧力を加えることが出来る。そして、可撓性材料で基板を加圧する装置では、剛性の高い定盤を使用する装置に比べて加圧の均一性はかなり改善され、ギャップ不良に伴う表示むらは減少する。

【0005】又、加熱方法としては、パネル全面を加熱できるように2枚1組の基板を挟む上・下定盤に加熱手段を配置したものが特開平5-232420号として提案されているが、この構成によれば炉中のヒータを用いてパネル側面を加熱する方法に比べて高速加熱性、及び均熱性は改善された。

## 【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかし、定盤の一方を可撓性部材とすることで上・下基板間のギャップ不良はある程度防止することが出来るが、上・下基板の横方向のズレや、基板の反りの発生を防止することはできなかった。特に、生産性向上のために1つの容器の中に2組のパネルを並べて配置した場合は、横方向のズレが大きくなることが分かった。

【0007】又、上・下定盤に加熱手段を配置した装置においては上下から熱が伝わるため、反りは少なくなるが、上・下のガラス基板の数 $\mu\text{m}$ 程度のズレを防止することができず、この位置精度が液晶の性能向上とともに厳しくなるにつれて、基板のズレは許容できない値となってきた。更に、従来構造において、2枚1組のガラス基板を定盤の中心に配置した場合に比べ、中心からずらした場合や、小さな基板を複数並置した場合にズレが大きくなることが実験によって明らかとなった。これらの結果から、上下定盤の熱膨張係数の差や上下定盤及び定盤の位置による定盤と基板間の摩擦係数の差によって、定盤-基板間、基板-基板間にせん断力が発生し、特に周縁部のみがシール材で接着される上・下基板間で最も力が解放され易くなり、上・下基板間でズレが発生するということが実験によって明らかとなった。更に、上記従来装置においては均熱性を確保するには上下の加熱手段の熱容量を大きくすることが有効であるが、加熱・冷却速度が犠牲にされるという問題を有している。特に、量産装置を考えた場合は、装置がラインのタクトタイムに見合う数用意されることになる。又、プロセス上の理由からパネルは、装置にセットされる時少なくとも基板に接触する部分は、ある温度以下に冷却されている必要がある。

【0008】本発明は上述したような従来の技術が有する問題点を鑑みてなされたもので、その目的とするところは、ガラス基板の全面を均一に加熱できると共に、該ガラス基板の加圧も均一な分布荷重として作用させることができ、更に加熱処理後定盤を素早く冷却できる液晶パネル製造装置を提供することにある。

## 【0009】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために本発明が講じた技術的手段は、2枚のガラス基板をスペーサを介在させて向き合わせ、重ね合わせた状態で加熱・加圧し、上記2枚の基板間に配した熱硬化性樹脂からなるシール材を硬化させる液晶パネル製造装置において、位置合わせし、且つ仮止めされた2枚一組のガラス基板を挟着する一方の固定定盤と、その固定定盤と対向して該定盤との間隔を広狭可変すると共に、加圧手段で加圧される可動定盤とから成り、前記固定定盤は2層構造としてガラス基板に近い側の上層部材に冷却手段を埋設し、遠い側の下層部材に加熱手段を装備し、更に前記上・下層部材の接触状態を切り離す分離機構を設け、且つ可動定盤は加熱手段を装備した中空構造とすると共にガラス基板と当接する加圧面は可撓性を有する部材で構成したことを特徴とする。

【0010】上記固定定盤としては、剛性が高く熱伝導率の良い部材、例えば金属板或いは黒鉛板等を用いることができる。但し、ガラス基板に直接接する部材はガラス基板に近い熱膨張係数を有する部材に限られる。そして、この上下2層に分割した固定定盤は、ガラス基板に近い側の上層部材に冷却手段を埋設する。その冷却手段としては水冷式がよく、従って上層部材には冷却用パイプを配管するための通路を形成する。又、ガラス基板から遠い側の下層部材に加熱手段を装備することで、熱伝導によって均熱加熱が可能となる。

【0011】上記可動定盤は、平面形状が矩形状をした断熱機能を持った枠体の一侧に剛性の低い可撓性部材を張設したもので、その可撓性部材と枠体とで区画された中空部に加熱手段を内蔵することで可撓性部材を間接的に加熱し、装置全体の温度分布を少なくして、ガラス基板の均熱性を向上させる。可動定盤を構成する可撓性部材としては、剛性の低い黒鉛板、あるいはガラス基板の熱膨張係数と同程度の熱膨張係数を有するフィルム、例えばポリテトラフロロエチレン(PTFE)含浸ガラス繊維布、またはカーボン入りポリテトラフロロエチレン(PTFE)含浸ガラス繊維布等が挙げられる。

【0012】又、上記加熱手段は補助ヒータであるため、従来例のように上下のヒータの温度を同一に制御する必要はなく、固定定盤に装着した加熱手段に近い温度に設定しておけばよい。更に、その加熱手段としては、熱容量の小さいラバーヒータ付反射板が望ましい。反射板は、固定定盤に装着した加熱手段の温度の上げ方いかんでは、固定定盤からの熱を反射板で反射させることで、ラバーヒータの出力を最低限に絞れ、省エネルギーに貢献できる。其の反射板としては、アルミ板、或いは金、銀のコーティングを施した金属ミラーコーティング等が挙げられる。

【0013】更にまた、固定定盤における下層部材と上層部材との接合面を分離する分離機構としては、偏心カムを利用した機構、或いは油圧、空気圧を利用したシリ

ンダーによる機構などが挙げられる。

【0014】上記した手段によれば、可動定盤を中空構造としてガラス基板と接触する加圧面を固定定盤より剛性の低い可撓性部材で構成し、固定定盤と可動定盤の加圧面に剛性差をつけたことで、可動定盤の剛性の低い可撓性部材がガラス基板に密着して均一な分布荷重が与えられ、上下のガラス基板間のギャップは均一に形成される。そして、固定定盤は上・下層部材の二層構造とし、基板に近い側の上層部材に冷却手段を、基板から遠い側の下層部材に加熱手段を装備したことで、急速冷却、急速加熱が可能となる。しかも、上記二層構造の固定定盤は分離機構によって接離自在に構成されていることで、加熱・加圧成形後、上・下層部材を切り離して上層部材を冷却すれば、冷却効率がよくなり、次のパネルをセットして熱履歴を与える際、パネル上での温度分布に悪影響を与えない。

【0015】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態の一例を図面に基づいて説明する。図1は液晶パネル製造装置の概略を示し、位置合わせし、且つ仮止めされた2枚一組のガラス基板を挟着して、加熱・加圧し、ガラス基板間に装着されたシール材を所定のギャップまで加圧し、硬化させるもので、図中、1は上・下層部材の二層構造からなる固定定盤、2は前記固定定盤1の上方に対向して配置した可動定盤、3は固定定盤1を構成する上・下層部材1a、1bの接合状態を上下方向に切り離す分離機構である。

【0016】上記固定定盤1は、液晶パネルを構成する2枚一組のガラス基板を載承するもので、剛性の高い黒鉛板で構成した平面形状が矩形状の上層部材1aと下層部材1bとからなり、ガラス基板と接触する上層部材1aには冷却手段4の冷却水配管を挿入設置し、下層部材1bには加熱手段5のヒータを挿入配置する。そして、上記上・下層部材1a、1bはガラス基板を加熱・加圧する時、対向する面(接合面)は接触状態に保持して下層部材1bに挿入配置した加熱手段5の熱が上層部材1aに伝達されてガラス基板の加熱を効果的に行うことが出来るように構成されている。

【0017】又、上記上・下層部材1a、1bの接合面はそれぞれ平坦面に形成して全面が接触するように構成しても、或いは上・下層部材1a、1bのいずれか一方の接合面にその周囲を除いて凹所を形成し、その凹所の空気層を介して下層部材1bの熱が上層部材1aに熱伝達されるように構成してもよい。この凹所を形成した場合は固定定盤1の均熱性及び平坦性を改善することが出来る。尚、上・下層部材1a、1bの接触は、平坦度を良くしても接触抵抗は大きく、熱バランスをとって均熱性を高めることも難しい。其の為に、平坦度を高める代わりに、クッション性がある、且つ熱伝導率の良いフィルム、例えば黒鉛繊維フィルムを上層部材1aと下層

部材1bとの間に介在する。そして、上・下層部材1a, 1bは常に安定した接触状態を維持するように上層部材1aと下層部材1bの周囲の数箇所にスプリング6を張設する。このスプリング6の作用で上・下層部材1a, 1bの間に挟んだ黒鉛繊維フィルムが圧縮され、上・下層部材1a, 1bの間の隙間が埋められ、均熱性が得られる。

【0018】又、固定定盤1におけるガラス基板と接触する上層部材1aの上面周囲には該固定定盤1の上面に載置される2枚一組のガラス基板a, bの周囲を取り囲むように枠7を配置固定する。この枠7は、ガラス基板a, bの総厚さと同じ厚さとし、その枠7の外側にはOリング8が取付けられ、後述する可動定盤2を下降させてガラス基板に当接させた時、固定定盤1と可動定盤2及びOリング8とで閉空間が区画され、その内部空間は通路9を通じて真空排気し得るように構成されている。

【0019】固定定盤1の上方に配置される可動定盤2は、前記した固定定盤1より数回り大きい断熱機能を有する矩形の枠体2aの側開口面(下面)に可撓性部材からなる加圧板2bを張設して構成する。その加圧板2bとしては、ガラス基板と同程度の熱膨張率を有し、且つ可撓性を有するシートで、例えば、ポリテトラフロロエチレン(PTFE)含浸ガラスクロスを使用する。そして、静電気が問題になる場合は、カーボン入りポリテトラフロロエチレン(PTFE)含浸ガラスクロスを使用するとよい。上記加圧板2bの取付けは、加圧板2bを構成するシートの縁を枠体2aの外側面に沿って立ち上げ、その立ち上げた縁部をシート固定金具11で押え、シート固定金具11をビス12で固定する。尚、加圧板2bの張設は中央部が下方に向けて多少垂れ下がるくらいに弛ませて固定する。

【0020】又、上記可動定盤2の内部、即ち枠体2aの内側で加圧板2bより上方位置には加熱手段10が収容配置されている。この可動定盤2に求められる性能は、平面均熱性と固定定盤1との上下の温度関係である。従って、加圧板2bに温度むらが発生しにくい加熱手段10の装備が望まれる。其の構造としては、図2に示すように、平面均熱性が高く、熱容量の小さいラバーヒーター付反射板を加圧板の上方に吊下げ支持する。このラバーヒーター付反射板10は、シリコンラバーヒーター10aの下面に反射板10bを取付けたもので、固定定盤1の上層部材1bからの熱を反射板10bで反射させることで、ラバーヒーター10aの出力を最低限に絞れ、省エネルギーに貢献することができる。また、反射板10bとしては、アルミ板、或いは金属ミラーコーティングを施した平板等が挙げられる。

【0021】以上の如く構成した可動定盤2は支持部材13に吊下げ支持し、支持部材13を下方に移動させることで加圧板2bを固定定盤1のOリング

【0022】固定定盤1を構成する上・下層部材1a,

1bを接触状態から切り離す分離機構3は、偏心シャフト14を利用したもので、固定定盤1の左右両側にそれぞれ2台を中心から前後方向に等距離の間隔をおいて設置し、それら分離機構を同時に作動させることで上層部材1aを下層部材1bとの接触から切り離して上方に持ち上げる。その分離機構3は、ハウジング15に偏心シャフト14をベアリング16を介して回転可能に支持し、その偏心シャフト14の先端側、即ち上層部材1aの下面を支持する箇所にはベアリング16'が取付けられ、偏心シャフト14の基端側はロータリーシリンダー17の出力軸にカップリング18で連結され、ロータリーシリンダー17の回転で偏心シャフト14が回転するように構成されている。そして、その偏心シャフト14の回転によりベアリング16'を介して上層部材1aが寸法だけ持ち上げられ、下層部材1bとの接触が切り離される。尚、分離機構3における偏心シャフト14を回転させる駆動源としては上述したロータリーシリンダー(空気式アクチュエーター)に限定されるものではなく、電動モータでもよいものである。又、上・下層部材1a, 1bは上述した分離機構3の動作時、両者の相対的な位置関係がズレないように案内支柱等で支持してある。

【0023】次に上述した製造装置の動作について説明すると、固定定盤1に対して可動定盤2を上方に引き上げた開いた状態で、位置合わせし且つ仮止めされた2枚一組のガラス基板a, bを固定定盤1の上層部材1aの上面に載置する。次に、可動定盤2を下方に下げて該定盤の加圧板2bをOリング8に接触させ、加圧板2bとOリング8と上層部材1bとで閉空間を形成し、固定定盤1の通路9を通して前記閉空間の内部を真空排気する。それにより、可動定盤2の加圧板2bはガラス基板aに沿うように、変形して密着し、ガラス基板a, bは加圧される。そして、其の状態で固定定盤1の加熱手段5と、可動定盤2の加熱手段10を作動させると固定定盤1は下層部材1bから熱伝導で上層部材1bが加熱され、熱伝達によってガラス基板a, bを加熱し、従来と同様にしてガラス基板a, b間のシール材を所定のギャップまで圧縮して固着する。この時、加熱と共にガラス基板a, b及び固定定盤1、可動定盤2の加圧板2bも熱膨張するが、固定定盤1及び加圧板2bは熱膨張係数がガラス基板と略同一であるためズレは抑制できる。尚、前記加熱は可動定盤2の加熱手段10がヒーター付反射板である場合は、固定定盤1からの熱が反射板10bで反射されてガラス基板aの加熱に貢献するため加熱手段10自体のヒーターの出力を最低限に絞ることが出来る。

【0024】上記の加熱・加圧による成形後、固定定盤1の加熱手段5と可動定盤2の加熱手段10のヒーターを切り、前記閉空間を大気圧に戻し、可動定盤2を上方に移動させて固定定盤1上の成形品(貼り合わせガラス

基板)を取り出す。そして、取り出した後固定定盤1の上層部材1aの冷却手段4を作動させて該固定定盤1を冷却するが、冷却手段4を備えた上層部材1aが加熱された下層部材1bと接触した状態のまま冷却した場合、所定の温度まで冷却するのに要する時間が長くなると共に、熱のロスが非常に大きくなり冷却効率が悪く、生産性に大きく影響することになる。其の為、本製造装置は上下二層構造の固定定盤を分離機構で切り離し自在とすることで、加熱成形後の冷却時は上層部材1aと下層部材1bを切り離し、下層部材1bの熱影響を無くした状態で上層部材1aを冷却することができる。そして、上記操作により次のガラス基板が載せられる上層部材1aの表面温度を所定の温度以下に素早く冷却でき、次のガラス基板をセットして熱履歴を与えるに際して、基板上での温度分布にバラツキがでるのを防止できる。一方、加熱時、上層部材1aと下層部材1bを接触させ、上層部材1aの冷却能力でガラス基板の温度プロフィールをフレキシブルに設定する運転も可能となる。

【0025】

【発明の効果】本発明の液晶パネル製造装置は請求項1に記載の構成により、ガラス基板の全面を均一に加熱できると共に、該ガラス基板の加圧も均一な分布荷重として加圧でき、更に加熱処理後、ガラス基板が載置される側の定盤表面を所定の温度以下に素早く冷却することが

できる。又、請求項2に記載の構成により、ガラス基板を上下の加熱手段で加熱する際、下側の熱を反射板で反射させてガラス基板に効果的に作用させることができるため、可動定盤側に装備するヒーターは熱容量の小さいもので良く、省エネルギーに貢献できる装置を提供できる。更に、請求項3に記載の構成により、加熱時の熱膨張によるズレを抑制できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の製造装置の実施の形態の一例を示す一部切欠正面図である。

【図2】 可動定盤の構造を示す拡大断面図である。

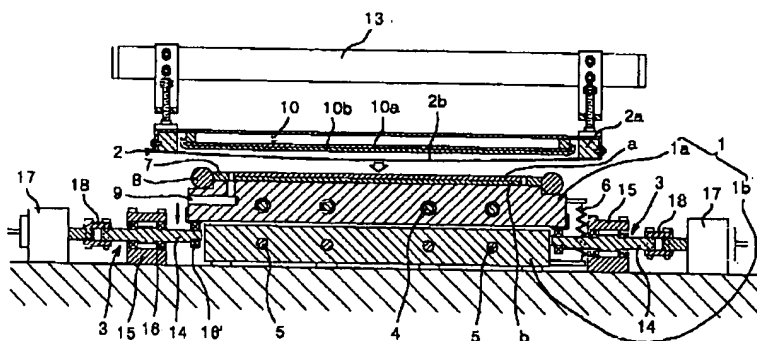
【図3】 固定定盤の上・下層部材を切り離す分離機構の配置を示す平面図である。

【図4】 偏心シャフトによる分離機構の動作を示す説明図で、(a)は上層部材が下層部材と接触している状態、(b)は上層部材が分離機構で上方へ移動された状態を示す。

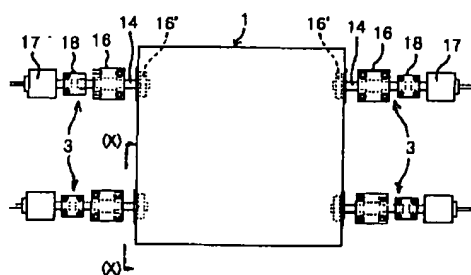
【符号の説明】

- |            |                |
|------------|----------------|
| 1…固定定盤     | 1a…上層部材        |
| 1b…下層部材    | 2…可動定盤         |
| 3…分離機構     | 4…冷却手段         |
| 5…加熱手段     | 10…加熱手段(可動定盤側) |
| a, b…ガラス基板 |                |

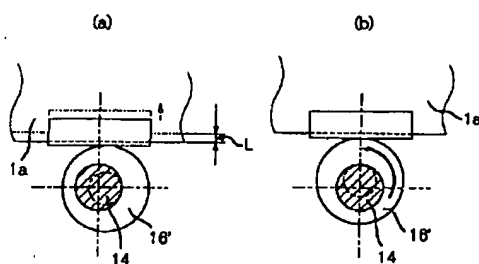
【図1】



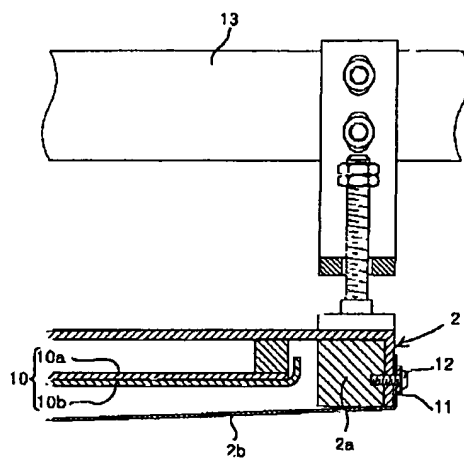
【図3】



【図4】



【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 古閑 泰行  
東京都千代田区神田錦町2丁目9番地 信  
越エンジニアリング株式会社内

(72)発明者 片桐 清男  
東京都千代田区神田錦町2丁目9番地 信  
越エンジニアリング株式会社内  
Fターム(参考) 2H089 KA01 NA37 NA60 QA16